

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】令和7年1月28日(2025.1.28)

【国際公開番号】WO2022/172823

【出願番号】特願2022-580575(P2022-580575)

【国際特許分類】

C 2 5 D 3/38(2006.01)

C 2 5 D 7/00(2006.01)

C 2 5 D 7/12(2006.01)

C 0 7 D 251/32(2006.01)

10

【F I】

C 2 5 D 3/38 1 0 1

C 2 5 D 7/00 J

C 2 5 D 7/12

C 0 7 D 251/32 D

【手続補正書】

【提出日】令和7年1月20日(2025.1.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0003】

電解めっき液に用いられる一般的な添加剤としては、ポリエチレンイミン、ポリアニリン、ポリアクリルアミド、ポリビニルピリジン、ポリビニルイミダゾール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミドなどがある。例えば、特許文献1には、微細銅配線埋め込み用電気銅めっき水溶液に用いられる平滑剤として、ポリビニルピロリドンが開示されている。また、特許文献2には、銅被膜形成用銅めっき液に用いられる平滑剤として、ポリエチレンイミンが開示されている。また、特許文献3には、非シアン系の酸性銀めっき浴に用いられる平滑剤として、ポリエチレンイミンが開示されている。また、厚さの均一性の高い金属層を得ることを目的として、エポキシ化合物とアミン化合物との反応生成物を電解めっき液用添加剤として用いることが知られている。例えば、特許文献4には、平滑化剤として、1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテルと2,4-ジメチルイミダゾールとの反応生成物が開示されている。また、特許文献5には、グリセロールジグリシジルエーテルとイミダゾールとの反応生成物が開示されている。また、特許文献6には、1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテルと、N-メチルアニリンやジフェニルアミンとの反応生成物が開示されている。

30

40

50